

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 1 区分
 【発行日】平成23年2月3日 (2011.2.3)

【公表番号】特表2010-513213(P2010-513213A)
 【公表日】平成22年4月30日 (2010.4.30)
 【年通号数】公開・登録公報2010-017
 【出願番号】特願2009-542797(P2009-542797)
 【国際特許分類】

C 0 4 B 28/14 (2006.01)
 C 0 4 B 24/20 (2006.01)
 C 0 4 B 22/06 (2006.01)
 C 0 4 B 22/10 (2006.01)
 C 0 4 B 22/16 (2006.01)
 C 0 4 B 22/08 (2006.01)
 C 0 4 B 24/00 (2006.01)

【 F I 】

C 0 4 B 28/14
 C 0 4 B 24/20
 C 0 4 B 22/06 Z
 C 0 4 B 22/10
 C 0 4 B 22/16
 C 0 4 B 22/08 A
 C 0 4 B 24/00

【手続補正書】
 【提出日】平成22年12月10日 (2010.12.10)
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

水、焼成石膏、ナフタレンスルホネート分散剤、並びに該ナフタレンスルホネート分散剤の効力を増す化学構造を有する少なくとも 1 つの変性剤を含む石膏スラリーであって、
該変性剤が、石灰、ソーダ灰、炭酸塩、珪酸塩、リン酸塩、ホスホネートおよびこれらの組み合わせからなる群から選ばれることを特徴とする石膏スラリー。

【請求項 2】

該変性剤が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約 0.1 重量% から約 0.25 重量% の濃度で存在する請求項 1 の石膏スラリー。

【請求項 3】

該スラリーの pH が約 9 より低い請求項 1 又は 2 に記載 の石膏スラリー。

【請求項 4】

該ナフタレンスルホネート分散剤が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約 0.05 重量% から約 0.5 重量% の濃度で存在する請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載 の石膏スラリー。

【請求項 5】

該水が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約 0.4 重量% から約 0.8 重量% の濃度で存在する請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載 の石膏スラリー。

【請求項 6】

少なくとも 1 つの外装材、並びに請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の水和された石膏スラリーを含有する石膏芯を含むことを特徴とする石膏パネル。

【請求項 7】

該変性剤が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約 0 . 0 5 重量 % から約 0 . 2 5 重量 % の濃度で存在する請求項 6 の石膏パネル。

【請求項 8】

該ナフタレンスルホネート分散剤が、該焼成石膏の乾燥重量に基づいて約 0 . 0 5 重量 % から約 0 . 5 重量 % の濃度で存在する請求項 6 又は 7 の石膏パネル。

【請求項 9】

ナフタレンスルホネート分散剤の効力を増す化学構造を有する変性剤を選択し、変性剤、ナフタレンスルホネート分散剤、水および焼成石膏を組み合わせる石膏スラリーを形成する方法であって、該変性剤が、石灰、ソーダ灰、炭酸塩、珪酸塩、リン酸塩およびセメントからなる群から選ばれることを特徴とするナフタレンスルホネート分散剤を含む石膏スラリーの製造方法。

【請求項 10】

該組み合わせ工程が、焼成石膏の添加前に、ナフタレンスルホネート分散剤および変性剤と水とを組み合わせることをさらに含む請求項 9 の方法。